(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



| 1741 | 1860 | 1 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1761 | 1771 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1

(43) 国際公開日 2004年5月27日(27.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/043961 A1

(51) 国際特許分類7:

C07D 477/06, C07F 7/18

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/014420

(22) 国際出願日:

2003年11月13日(13.11.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2002-330128

2002年11月13日(13.11.2002) IP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 鑓淵化 学工業株式会社 (KANEKA CORPORATION) [JP/JP]; 〒530-8288 大阪府 大阪市 北区中之島3丁目2番4号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西野 敬太 (NISHINO, Kelta) [JP/JP]; 〒676-8688 兵庫県 高砂市 高砂町宮前町 1-8 鐘淵化学工業株式会社高砂工業 所内 Hyogo (JP). 古賀 照義 (KOGA, Teruyoshi) [JP/JP]; 〒676-8688 兵庫県 高砂市 高砂町宮前町 1-8 鐘淵 化学工業株式会社高砂工業所内 Hyogo (JP).

- (74) 代理人: 安富 康男 . 外(YASUTOMI, Yasuo et al.); 〒 532-0011 大阪府 大阪市 淀川区西中島 5 丁目 4 番 20号中央ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特 許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM). ヨーロッ パ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: PROCESS FOR PRODUCING CARBAPENEM COMPOUND FOR ORAL ADMINISTRATION
- (54) 発明の名称: 経口投与用カルパペネム化合物の製造方法

(1)

(2)

(57) Abstract: A process for efficiently producing a 1 β -methylcarbapenem compound for oral administration. The process, which is for producing a 1 β -methylcarbapenem compound represented by the general formula (2), is characterized by reacting a β -lactam compound represented by the general formula (1) as a starting material with a thiol compound (R3-SH) in the presence of a base and optionally eliminating the protective group R₁. (1) (2) (In the formulae, R₁ represents hydrogen, trimethylsilyl, or triethylsilyl; R₂ represents C₁₋₁₀ alkyl or C₃₋₁₀ cycloalkyl; R₃ represents an organic group; and R₄ represents hydrogen, trimethylsilyl, or triethylsilyl.)

(57) 要約:

本発明は、経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物の効率的な製造方法を提供する。つまり、本発明は、一般式(1)で表される β -ラクタム化合物を出発原料とし、塩基の存在下にチオール化合物(R_3 -SH)と反応させ、必要に応じて保護基 R_1 を脱保護することを特徴とする、一般式(2)で表される 1β -メチルカルバペネム化合物の製造方法である。

(式中、 R_1 : 水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基、 R_2 : 炭素数 $1\sim10$ のアルキル基または炭素数 $3\sim10$ のシクロアルキル基、 R_3 : 有機基、 R_4 : 水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示す)

WO 2004/043961

PCT/JP2003/014420

1

明細書

経口投与用カルバペネム化合物の製造方法

技術分野

5 本発明は経口投与用1βーメチルカルバペネム化合物の効率的かつ極めて有用な製造方法に関する。

背景技術

1 βーメチルカルバペネム化合物は広範囲の病原菌に対して優れた抗菌作用を 10 示し、かつ生体内での安定性にも優れていることから最も注目されている抗菌剤 のひとつである。そのため、近年、経口投与用薬剤の研究開発が精力的に進められている。経口投与用1 βーメチルカルバペネム化合物の製造方法としては、現在、以下のような方法が一般的に用いられている。

例えば、特開平8-53453号公報や、ザ・ジャーナル・オブ・アンチビオ 5 ティックス (J. Antibiot.)、429~439頁、1997年に記載 されているように、式 (6):

$$\begin{array}{c|c}
OH & H & CH_3 \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O & O & O & O \\
\hline
O &$$

25 で表される化合物を各種チオール化合物 (R-SH) と反応させて、式 (7):

$$H_3$$
C OH H CH_3 $S-R$ CO_2 NO_2

(式中、Rはチオール残基を示す)で表される化合物を合成し、例えば加水素分解反応や、亜鉛末による還元反応により保護基であるpーニトロベンジル基を除10 去し、式(8):

$$H_3C$$
 N
 $S-R$
 CO_2H
 (8)

15

5

(式中、Rはチオール残基を示す)で表される化合物に変換し、さらに得られた 化合物(8)のカルボン酸部位を例えばピバロイルオキシメチル化することによ り、式(9):

$$H_3C$$
 H_3C
 CO_2
 O
 Bu^t

25

(式中、Rはチオール残基を示し、 Bu^t はtertーブチル基を示す)で表される化合物を製造する方法である。

上記式(9)で表される化合物としては、例えば、前記特開平8-53453 号公報および特開平10-195076号公報には、式(10):

15

20

25

3

で示される化合物が記載されており、

また、前記ザ・ジャーナル・オブ・アンチビオティックス (J. Antibiot.)、429~439頁、1997年および特開平10-130270号公報 10 には、式 (11):

$$H_3C$$
 H_3C
 NH
 CH_3
 CO_2
 O
 Bu^t

で示される化合物が記載されており、

さらに、特開平10-152491号公報には、式(12):

$$H_3C$$
 H_3C
 S
 CO_2
 O
 Bu^t
 O
 Bu^t

で示される化合物が記載されているが、これらは全て上記方法にて合成されている。

しかしながら、これらの製造方法では経口投与用1βーメチルカルバペネム化

20

合物を合成するのに、カルボン酸保護基の付け換えを必要とし、多段階の反応を 経る必要があるため非効率的であり、また、最終物のチオール残基となる比較的 高価なチオール化合物を合成初期段階で用いることから、製造コスト面で不利と なり、問題となっていた。

5 また、特開平8-59663号公報および特開2000-344774号公報 には、式(13):

$$H_3C$$
 H_3C
 H_3C
 R_6
 R_7
 R_7
 R_7

(式中、 R_5 は水酸基保護基を示し、 R_6 は生成物である 1β ーメチルカルバペ 15 ネム化合物中に含まれるチオール残基を示し、 R_7 は有機基を示す)で表される 化合物から、式(14):

$$H_3C$$
 N
 CH_3
 R_6
 CO_2
 CO_2
 R_7
 R_7
 R_7
 R_7

(式中、 R_5 、 R_6 、 R_7 は前記と同じ意味を示し、 R_8 、 R_9 、 R_0 は全て炭素数 $1\sim 4$ の低級アルコキシ基であるか、あるいはひとつが炭素数 $1\sim 4$ の下ルキル 基で残りふたつが炭素数 $1\sim 4$ の低級アルコキシ基を示す)で表される化合物を合成し、これを環化させることにより、式(15):

15

$$H_3C$$
 OR_5
 H
 CH_3
 $S-R_6$
 CO_2
 O
 R_7
 R_7

(式中、 R_5 、 R_6 、 R_7 は前記と同じ意味を示す)で表される化合物を製造する 方法が記載されている。

10 しかしながら、本製造方法においても先述と同様に、最終物のチオール残基となる比較的高価なチオール化合物を合成初期段階で用いることから、製造コスト面で不利であり問題となっていた。

また、ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (J. Org. Chem)、第61巻、7889~7894頁、1996年、および特開平5-279367号公報には、式 (16):

Me But
$$H_3C$$
 H_3C H_3C

(式中、Meはメチル基を示し、Bu は前記と同じ意味を示す)で示される化合物が記載されており、該化合物を各種チオール化合物との反応及び水酸基の脱保護により 1β ーメチルカルバペネム化合物に導くことが考え得る。しかしながら、上記化合物(16)においては、水酸基の保護基が tert ープチルジメチルシリル基であるため、Protective Groups in Organic Synthesis (J Wiley & Sons, New Yor

k)、44~46頁、1981年に例示されているように、水酸基部位の脱保護には他の官能基に影響を及ぼすような反応試剤を使用する必要があり、収率等の点で問題がある。本発明者らは脱保護の方法を種々検討したが、容易かつ効率の良い脱保護を行うことは困難であった。

5 以上のような状況の中、経口投与用 1·β - メチルカルバペネム化合物の効率的 かつ製造コスト面で有利な製造方法の開発が望まれていた。

発明の要約

上記現状を鑑み、本発明者らは経口投与用1 B ーメチルカルバペネム化合物の 6 合成において、最終段階にて一段でチオール化合物が導入できるような製造方法 の開発に関して鋭意検討した結果、本発明に至った。

即ち、本発明は、一般式(1):

20 (式中、 R_1 は水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示し、 R_2 は炭素数 $1\sim 1$ 0 のアルキル基または炭素数 $3\sim 1$ 0 のシクロアルキル基を示す)で表される化合物と、一般式(3):

$$R_3$$
—SH (3)

25 (式中、 R_3 は有機基を示す)で表されるチオール化合物を塩基の存在下に反応 させ、必要に応じて保護基 R_1 を脱保護することを特徴とする、一般式(2): WO 2004/043961

PCT/JP2003/014420

$$R_{3}$$
C
 R_{4}
 R_{2}
 R_{2}
 R_{2}

(式中、 R_2 、 R_3 は前記と同じ意味を示し、 R_4 は水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示す)で表される化合物の製造方法である。

10 発明の詳細な開示

5

15

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明は、一般式(1):

$$H_3$$
C
 CO_2
 CO_2

20 で表される化合物と、一般式(3):

$$R_3$$
—SH (3)

で表されるチオール化合物を塩基の存在下に反応させ、必要に応じて保護基 R_1 を脱保護することを特徴とする、一般式(2):

25

PCT/JP2003/014420

WO 2004/043961

$$R_{3}$$
C R_{4} R_{2} R_{2} R_{2}

で表される化合物の製造方法である。

まず、各化合物における置換基について説明する。置換基 R_1 は水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示す。置換基 R_1 が水素原子である場合には、置換基 R_4 が水素原子である化合物(2)が得られる。一方、置換基 R_1 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である化合物(1)からは、置換基 R_4 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である化合物(2)が生成する。この場合、生成物として得られる置換基 R_4 を持つ化合物(2)は、従来知られている前記式(1 6)で表される化合物とは異なり、容易に水酸基を脱保護することが可能であり、置換基 R_4 が水素原子である化合物(2)を得ることができる。置換基 R_1 は、生成物として得られる化合物(2)の脱保護反応に対して、化合物中の他の官能基部分を極力分解させることなく、穏和な反応条件にて除去できるものとして選定されている。脱保護を容易なものとするため、置換基 R_1 が水酸基保護基である場合には、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である必要があり、トリメチルシリル基が特に好ましい。

置換基 R_2 は最終的に経口投与用 $1\beta-$ メチルカルバペネム化合物として開発されうる化合物中のカルボン酸エステル残基のアルカノイルオキシメチル基部位に含まれてくるものであり、炭素数 $1\sim10$ のアルキル基または炭素数 $3\sim10$ のシクロアルキル基を示す。

25 炭素数1~10のアルキル基の例としてはメチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、イソプロピル基、ノルマルプチル基、イソプチル基、secープチル基、tertープチル基、ノルマルオクチル基、ノルマルデカニル基等が挙げられる。 炭素数3~10のシクロアルキル基は置換基を有していてもよく、置換基としてはメチル基、エチル基等の炭素数1~4のアルキル基等が挙げられる。 炭素数

5

10

15

20

3~10のシクロアルキル基の例としてはシクロプロピル基、シクロヘキシル基、 1-メチルシクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基等が挙げられる。

置換基R₂としては、なかでも経口投与用カルバペネム化合物の開発でよく使用されるtertーブチル基が特に好ましい。

5 置換基 R_3 は有機基を示し、最終的に経口投与用 1β - メチルカルバペネム化 合物として開発されうる化合物中のチオール残基に含まれてくるものが好ましい。 より好ましくは、一般式(3):

$$R_3$$
—SH (3)

10 (式中、R₃は有機基を示す)で表されるチオール化合物のチオール残基として、 次式(4): N₂

$$HS \longrightarrow N \longrightarrow N$$
 (4)

で示される、特開平8-53453号公報に記載の化合物のチオール残基、次式 15 (5):

で示される、ザ・ジャーナル・オブ・アンチビオティックス (J. Antibi 20 ot.)、429~439頁、1997年に記載の化合物のチオール残基、次式 (19):

25 で示される、特開平10-152491号公報に記載の化合物のチオール残基等 が挙げられる。

置換基 R_3 として、好ましくは式(4)で示される化合物のチオール残基、式(5)で示される化合物のチオール残基である。

置換基R₄は、水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示

し、上述したように、置換基 R_4 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である場合には、必要に応じ、脱保護を行うことにより、容易に経口投与用1 β -メチルカルバペネム化合物を得ることができる。

次に本発明の製造方法について説明する。

5 本発明において使用される出発原料の前記式(1)で表される化合物は、下記式(17):

$$H_3C$$
 H_3C
 R'
 $COOH$
 $COOH$
 $COOH$

10

15

(式中、R'は置換基を有していてもよいアリール基またはヘテロアリール基を示す)で表される化合物から誘導でき、その一例を後記参考例 $1\sim4$ として詳細に記載した。なお、上記式(17)で表される化合物は、ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブルティン(Chem.Pharm.Bull.)、4 2巻、 $1381\sim1387$ 頁、1994年の記載に従い、容易に調製可能である。上記化合物(1)と、前記式(3)で表されるチオール化合物を塩基の存在下に反応させることにより、前記式(2)で表される 1β -メチルカルバペネム化合物が得られる。

20 該反応は化合物(1)を分解させないような不活性溶媒を用いて行われる。不 活性溶媒としては特に限定はされないが、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジ エチルエーテル等のエーテル系溶媒;ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族 炭化水素系溶媒;N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミ ド等のアミド系溶媒;ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、アセトン、塩化 メチレン、およびそれらの混合溶媒等が挙げられる。反応速度の点から、N,N ージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、アセトニトリルが特 に好ましい。

反応に使用されるチオール化合物(3)の量は、化合物(1)に対して、1. 0倍モル量以上必要であり、好ましくは1. $1\sim3$. 0倍モル量である。また、

チオール化合物 (3) は、塩酸塩等の塩を形成していてもよい。

また、使用される塩基としては、有機アミン類、アルカリ金属塩、アルカリ金属アルコキシド、アルカリ金属アミド、アルカリ金属水素化物等が挙げられる。

有機アミン類としては、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、4 -ジメチルアミノピリジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-ウンデシ -7-エン (DBU)、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]-ノン-5-エ ン (DBN)、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン (DABCO) 等が例示される。有機アミン類を使用する場合には、その使用量は化合物 (1) に対し1.0倍モル量以上が必要であり、1.1~3.0倍モル量が好ましい。

10 アルカリ金属塩としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム等の 炭酸アルカリ塩;重炭酸ナトリウム、重炭酸カリウム等の重炭酸アルカリ塩等が 例示される。その使用量は化合物(1)に対し、炭酸アルカリ塩使用時には0. 5倍モル量以上が必要であり、重炭酸アルカリ塩使用時には1.0倍モル量以上 が必要であるが、共に1.1~2.0倍モル量が好ましい。

15 アルカリ金属アルコキシドとしては、カリウムtertーブトキシド、ナトリウムtertープトキシド等が例示される。アルカリ金属アルコキシドを使用する場合には、その使用量は化合物(1)に対し1.0倍モル量以上が必要であり、1.1~2.0倍モル量が好ましい。

アルカリ金属アミドとしては、リチウムビス (トリメチルシリル) アミド、ナ 20 トリウムビス (トリメチルシリル) アミド、カリウムビス (トリメチルシリル) アミド等が例示される。アルカリ金属アミドを使用する場合には、その使用量は 化合物 (1) に対し1.0倍モル量以上が必要であり、1.1~2.0倍モル量 が好ましい。

アルカリ金属水素化物としては、水素化ナトリウム、水素化カリウム等が例示される。アルカリ金属水素化物を使用する場合には、その使用量は化合物(1)に対し1.0倍モル量以上が必要であり、1.1~2.0倍モル量が好ましい。

上記反応は通常 $-78\sim60$ ℃で実施されるが、反応物、生成物の分解抑制の理由から $-40\sim40$ ℃で行うのが好ましい。

また、反応時間は通常5分~40時間であるが、上記理由から1~30時間で

あることが好ましい。

また、当然のことではあるが、薄層クロマトグラフィー(TLC)、高速液体 クロマトグラフィー(HPLC)といった分析的手段により該反応の経時変化を 知ることができる。

反応後の混合物から、通常有機反応においてしばしば用いられるpH調節、抽出、分液、洗浄、濃縮、精製などの操作を経て、目的化合物(2)を単離することができる。

化合物 (1) の置換基 R_1 が水素原子である場合には、上記反応にて、置換基 R_4 が水素原子である化合物 (2) が得られ、直接、経口投与用 1β ーメチルカ 10 ルバペネム化合物を合成することができる。

一方、置換基 R_1 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である場合には、それぞれ置換基 R_4 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である化合物(2)へと誘導される。置換基 R_1 が上記の水酸基保護基(トリメチルシリル基又はトリエチルシリル基)である場合には、容易に離脱できる置換基として選定されているため、反応後の混合物から抽出、洗浄などの操作にてp H調節を行う際、酸性条件とすることで水酸基部位の脱保護を同時に行うことができ、置換基 R_4 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である化合物(2)から、容易に置換基 R_4 が水素原子である化合物(2)へと変換され、経口投与用1 β - メチルカルバペネム化合物を取得することができる。

20 上記で使用される酸性条件はpHが7以下の条件であれば特に制限はないが、pH2~6であることが好ましく、該pHにて該水酸基保護基が極めて容易に離脱される。また、当該酸性条件とするために、例えば、クエン酸水、塩酸等を抽出液等に添加することができる。

また、置換基R₄がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である場合、 25 化合物(2)を一旦取り出してから、別途脱保護を行ってもよく、この場合の脱 保護方法としては、上記方法に加えて、例えば、Protective Gro ups in Organic Synthesis (J Wiley & S ons, New York)、39~50頁、1981年に記載されているよう な、一般的なシリル保護基の脱保護条件を採用することができる。

本発明により、式 (1) で示される化合物と、式 (3) で示されるチオール化合物から、式 (2) で示される 1β - メチルカルバペネム化合物を、短段階にて効率的かつ容易に合成することができる。本発明は、式 (3) で示されるチオール化合物として特に式 (4) および (5) で示されるチオール化合物を用い、それぞれ式 (10);

(式中、Bu^tはtertープチル基を示す)、および、式(11);

15
$$H_3C$$
 H_3C
 H_3C

(式中、B u t は前記と同じ意味を示す)で示される経口投与用1βーメチルカルバペネム化合物を合成する方法として好ましいものである。

25 発明を実施するための最良の形態

以下に実施例および参考例を挙げてさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの記載によって何ら限定されるものではない。なお、以下の実施例および参考例で用いた略号の意味は次のとおりである。

Me:メチル基

Bu^t:tertーブチル基

TMS:トリメチルシリル基

TES: トリエチルシリル基

5 (参考例1) <u>(3S, 4S) -4-[(1R) -1-(p-/クロロフェニルチオカルボニル) エチル] -3-[(1R) -1-ヒドロキシエチル] -1-ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジノンの製造</u>

$$10 \qquad \begin{array}{c} OH \\ H_3C \\ \hline \\ CO_2H \\ \end{array}$$

(3 S, 4 S) -1-カルボキシメチルー4-[(1 R) -1-(p-クロロフェニルチオカルボニル) エチル] -3-[(1 R) -1-ヒドロキシエチル] 15 -2-アゼチジノン8. 18g(22.0mmo1)をジメチルホルムアミド18mlに室温で溶解させ、塩化ビバロイルオキシメチル5.5ml(40.0mmo1)、ヨウ化ナトリウム5.75g(40.3mmo1)を順次添加し、ジイソプロピルエチルアミン4.2ml(25.3mmo1)を滴下した後、同温度で20時間攪拌した。反応液をトルエン120mlで希釈し、2.5%重曹水および水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を、芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。得られた油状残渣を室温でトルエン60mlに溶解し、ヘキサン120mlを添加すると結晶が析出した。これをろ別、洗浄することにより標記の白色結晶9.46gを得た(収率92.7%)。

NMR δ (CDCl₃): 1. 19 (9H, s), 1. 32 \sim 1. 34 (6H, 25 m), 3. 11 \sim 3. 18 (2H, m), 3. 87 (1H, d, J=18. 1H z), 4. 15 (1H, dd, J=2. 4, 4. 4Hz), 4. 22 \sim 4. 24 (1H, m), 4. 35 (1H, d, J=18. 1Hz), 5. 76 (2H, s), 7. 31 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 40 (2H, d, J=8. 8Hz)

15

20

25

(参考例2) <u>(4R, 5R, 6S) -6-[(1R) -1-トリメチルシリロキシエチル] -3-ジフェニルホスホリロキシー4-メチルー7-オキソー1ーアザビシクロ[3.2.0] ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピパロイルオキシメチルエステルの製造</u>

参考例1と同様にして合成した(3S, 4S) -4-[(1R) -1-(p- クロロフェニルチオカルボニル) エチル] -3-[(1R) -1-ヒドロキシエチル] -1-ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチルー2ーアゼチジノン1.997g(4.1mmo1)をトルエン20m1に溶解させ、室温にてトリエチルアミン0.88mL(6.4mmo1)を加え、塩化トリメチルシラン0.78mL(6.2mmo1)を滴下した後、同温度で15時間攪拌した。反応液をトルエン5m1で希釈し、水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

得られた油状残渣 2. 6 3 g にテトラヒドロフラン 2 2. 5 m 1 を加えて溶解させ、-70℃まで冷却し、カリウム t e r t ープトキシドを 0. 9 5 6 g (8. 5 m m o 1) 添加後、1 5 分攪拌した。次いで同温度でヨウ化メチル 0. 2 6 m L (4. 2 m m o 1) を添加し、-35℃まで徐々に昇温しながら 2 5 分攪拌後、続けて-35℃にて塩化ジフェニルリン酸 1. 0 m L (4. 9 m m o 1) を添加

し、-9℃まで徐々に昇温しながら1.8時間攪拌した。反応液をトルエン20mlで希釈し、氷冷下に2.5%重曹水および水で数回洗浄したトルエン溶液を 芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去して標記化合物を得た。

反応時の経時変化を追跡する手段として高速液体クロマトグラフィーにて分析を行ったが、反応液および得られた標記化合物をアセトニトリル/水/リン酸=700/300/1で混合した溶離液に溶解させ分析を行ったところ、参考例3で述べる生成物と同じ保持時間に検出されたことから、水酸基保護基であるトリメチルシリル基が容易に脱保護されることを確認した。

NMR δ (CDC1₃): 0. 11 (9H, s), 1. 19 \sim 1. 29 (15H, 10 m), 3. 24 (1H, dd, J=2. 9, 6. 6Hz), 3. 45 \sim 3. 50 (1H, m), 4. 07 \sim 4. 19 (2H, m), 5. 78 (1H, d, J=5. 5Hz), 5. 81 (1H, d, J=5. 5Hz), 7. 15 \sim 7. 40 (12 H, m)

15 (参考例3) <u>(4R, 5R, 6S) - 6 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル</u> <u>] - 3 - ジフェニルホスホリロキシー4 - メチルー 7 - オキソー1 - アザビシク</u> <u>ロ[3.2.0] ヘプトー2 - エンー2 - カルボン酸ピバロイルオキシメチルエ</u> ステルの製造

20
$$H_3C$$
 CO_2
 OH
 H_3C
 $OTMS$
 $OTMS$

参考例1と同様にして合成した(3S, 4S) -4-[(1R) -1-(p-クロロフェニルチオカルボニル) エチル] -3-[(1R) -1-ヒドロキシエチル] -1-ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチルー2-アゼチジノン0.97g(2.0mmo1)をトルエン5m1に溶解させ、室温にてトリエチルアミン0.50g(5.0mmo1)を加え、塩化トリメチルシラン0.39g(3.6mmo1)を滴下した後、同温度で15時間攪拌した。反応液をトルエンで希釈し、水で数回洗浄したトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

得られた油状残渣にテトラヒドロフランとトルエンの体積比が 1 対 2 である混 10 合溶媒 1 5 m 1 を加えて溶解させ、-25℃まで冷却し、カリウム t e r t ーブ トキシドを 0. 4 7 5 g (4. 2 m m o 1) 添加後、1 時間攪拌した。次いで同 温度でヨウ化メチル 0. 3 0 g (2. 1 m m o 1) を添加し、2 0 分攪拌後、続 けて塩化ジフェニルリン酸 0. 6 0 g (2. 2 m m o 1) を添加し、2. 5 時間 攪拌した。

15 反応液を氷冷下に酢酸エチルと水を添加し、1 N塩酸水にて混合溶液のp Hを3 として分離した酢酸エチル溶液を、重曹水および水で数回洗浄した後、芒硝により乾燥させ、溶媒を留去して標記化合物を得た。

NMR δ (CDC1₃): 1. 18~1. 20 (12H, m), 1. 29 (3H, d, J=4.9Hz), 3. 28 (1H, dd, J=2.4, 6.3Hz), 3. 45~3. 51 (1H, m), 4. 17~4. 21 (2H, m), 5. 77 (1H, d, J=5.5Hz), 5. 81 (1H, d, J=5.5Hz), 7. 21~7. 40 (12H, m)

(参考例4) (4R, 5R, 6S) -6-[(1R) -1-トリエチルシリロ キシエチル] -3-ジフェニルホスホリロキシー4-メチルー7-オキソー1ー アザビシクロ[3.2.0] ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造

20

参考例1と同様にして合成した(3S, 4S) -4-[(1R) -1-(p-クロロフェニルチオカルボニル) エチル] -3-[(1R) -1-ヒドロキシエチル] -1-ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチルー2-アゼチジノン0.493g(1.0mmo1)をトルエン10m1に溶解させ、室温にてトリエチルアミン0.17g(1.7mmo1)を加え、塩化トリエチルシラン0.24g(1.6mmo1)を滴下した後、同温度で22時間攪拌した。反応液をトルエン10m1で希釈し、水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

得られた油状残渣にテトラヒドロフラン 6m1 を加えて溶解させ、-25 ℃まで冷却し、カリウム t e r t ープトキシドを 0 . 232g (2. 1mmo1) 添加後、60分攪拌した。次いで同温度で臭化ベンジル 0 . 19g (1. 05mm o1) を添加し、20分攪拌後、続けて塩化ジフェニルリン酸 0 . 30g (1. 1mmo1) を添加し、2 時間攪拌した。反応液をトルエン 50m1 で希釈し、氷冷下に 2 . 5% 重曹水および水で数回洗浄したトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去して標記化合物を得た。

NMR δ (CDC1₃): 0. 59~0. 62 (6H, m), 0. 94 (9H, t, J=8. 1Hz), 1. 19~1. 28 (15H, m), 3. 23 (1H, dd, J=2. 9, 6. 6Hz), 3. 42~3. 46 (1H, m), 4. 13

(1H, dd, J=2. 9, 10. 3Hz), 4. $18\sim4$. 23 (1H, m), 5. 78 (1H, d, J=5. 5Hz), 5. 81 (1H, d, J=5. 5Hz), 7. $15\sim7$. 43 (12H, m)

5 (実施例1) <u>ピパロイルオキシメチル (1R, 5S, 6S) -2- [1-(1, 3-チアゾリン-2-イル) アゼチジン-3-イル] チオー6- [(1R) -1 -ヒドロキシエチル] -1-メチルーカルバペン-2-エム-3-カルボキシレートの製造</u>

10 OTMS
$$H_3$$
C H_3 C

25

20 参考例 2 にて合成した (4R, 5R, 6S) -6-[(1R) -1-トリメチルシリロキシエチル] -3-ジフェニルホスホリロキシー4-メチル-7-オキソー1-アザビシクロ[3.2.0] ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルを含む黄色油状残渣4.53gをアセトニトリル15m1に溶解させ、式(18):

$$HS \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow HCI \qquad (18)$$

で示される化合物 1. 10g (5. 1 mm o 1) を添加し、氷冷下にジイソプロピルエチルアミン 1. 8 m l (10. 3 mm o 1) を滴下後、同温度にて 1. 9

時間攪拌した。反応終了後、溶媒を留去し、酢酸エチル40m1および水100m1を添加し、重炭酸カリウム水、重曹水により洗浄した。得られた酢酸エチル溶液にクエン酸水を加えて酸性とし水層に抽出した後、酢酸エチル50m1および重炭酸カリウムを添加して再度酢酸エチル層へと抽出した。本溶液を重量が12gとなるまで溶媒を留去し、これにヘプタン25m1添加すると結晶が析出した。これをろ別、洗浄することにより標記化合物を含む白色結晶1.87gを得た。

NMR δ (CDCl₃): 1. 23 (9H, s), 1. 23 (3H, d, J=7. 1), 1. 34 (3H, d, J=6. 4Hz), 3. 13~3. 21 (1H, m)

10), 3. 23 (1H, dd, J=2. 7, 6. 8Hz), 3. 37 (2H, t, J=7. 6Hz), 3. 94~4. 03 (4H, m), 4. 10~4. 26 (3H, m), 4. 36~4. 42 (2H, m), 5. 84 (1H, d, J=5. 5Hz)

15 (実施例2) <u>ピバロイルオキシメチル(1R, 5S, 6S)-2-[1-(1, 3-チアゾリン-2-イル)アゼチジン-3-イル]チオ-6-[(1R)-1-ドロキシエチル]-1-メチルーカルバペン-2-エム-3-カルボキシレートの製造</u>

参考例3と同様にして合成し、精製した(4R,5R,6S)-6-[(1R) -1-ヒドロキシエチル]-3-ジフェニルホスホリロキシー4-メチルー7ーオキソー1-アザビシクロ[3.2.0]へプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルを含む油状残渣0.32gをアセトニトリル1 m1に溶解させ、式(18):

$$HS \longrightarrow N \longrightarrow N \qquad (18)$$

で示される化合物 0.07g(0.33mmol)を添加し、-10℃にてジイソプロピルエチルアミン 0.09g(0.70mmol)を滴下後、同温度にて3時間攪拌した。反応終了後、酢酸エチル20mlおよび水20mlを添加し、クエン酸水を加えて水層へ抽出した後、酢酸エチル20mlおよび重炭酸カリウムを添加して再度酢酸エチル層へと抽出した。本溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去し、NMR分析により標記化合物の生成を確認した。

15

10

25

22

参考例2と同様にして合成した(4R, 5R, 6S)-6-[(1R)-1-トリメチルシリロキシエチル] -3-ジフェニルホスホリロキシー4-メチルー 7ーオキソー1ーアザビシクロ[3.2.0] ヘプトー2ーエンー2ーカルボン 酸ピバロイルオキシメチルエステルを含む油状残渣4.32gをアセトニトリル 5 15m1に溶解させ、式(5):

で示される化合物 0.57g(4.9mmo1)を添加し、5℃にてジイソプロ ピルエチルアミン 0. 79g (6. 1 mm o 1) を滴下後、同温度にて 70分攪 拌した。反応終了後、アセトニトリルを留去し、酢酸エチル40m1に溶解させ、 重曹水にて数回洗浄することにより副生したジフェニルリン酸を除去した。得ら れた酢酸エチル溶液に水を添加後、1Nの塩酸水をpH3となるまで加えた。分 液操作により得られた酢酸エチル溶液を重曹水、水で洗浄した後、本溶液を芒硝 15 にて乾燥させ、さらに溶媒を留去し、アセトン20mLに溶解させた。これにト ルエン30mLを添加して、アセトン溶媒を徐々に留去し、白濁溶液となるのを 確認した。この白濁溶液を0~5℃にて1時間攪拌し、ろ別、洗浄することによ り白色結晶を得た。再度、アセトンに溶解させ、上記同様、トルエン添加及び溶 媒留去、攪拌、ろ別、洗浄の操作を経ることにより、標記化合物を含む白色結晶 0.70gを得た。

NMR δ (CDC1₃): 1. 22 (9H, s), 1. 27 (3H, d, J=7. 1) 1.32(3H, d, J=6.3Hz) 2.39(1H, dd, J=5.1, 17. 1 Hz) $\langle 2.83 (1 \text{ H}, dd, J=8.1, 17.1 \text{ Hz}) \langle 3.$ 26 (1H, dd, J=2. 4, 6.8Hz), 3.31~3.36 (1H, m 25) 3.84 (1H, dd, J=8.1, 10.7Hz) $4.01\sim4.06$ (1 H. m), 4. 22~4. 28 (2 H. m), 5. 82 (1 H. d.) J=5. 5 Hz) $\sqrt{5}$. 96 (1H, d, J=5. 5Hz)

(実施例4) <u>ピバロイルオキシメチル (1R, 5S, 6S) -2-[(3R)</u>

25

23

<u>-5-オキソピロリジン-3-イル</u>] チオー6- [(1R) -1-ヒドロキシエ チル] -1-メチルーカルバペン-2-エム-3-カルボキシレートの製造

参考例4と同様にして合成した(4R, 5R, 6S)-6-[(1R)-1-トリエチルシリロキシエチル]-3-ジフェニルホスホリロキシー4ーメチルー7-オキソー1ーアザビシクロ[3.2.0] ヘプトー2ーエンー2ーカルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルを含む油状残渣0.84gをアセトニトリル5m1に溶解させ、式(5):

で示される化合物 $0.12g(1.0 \,\mathrm{mmol})$ を添加し、 $0\sim5\,^{\circ}$ にてジイソプロピルエチルアミン $0.13g(1.0 \,\mathrm{mmol})$ を滴下後、同温度にて 3時間攪拌した。反応終了後、トルエン、水 $20\,\mathrm{ml}$ ずつを添加し、 $1\,\mathrm{No}$ 塩酸水を $p\,\mathrm{H2}$ となるまで加えた。分液操作により得られたトルエン溶液を重曹水、水で洗浄した後、本溶液を芒硝にて乾燥させ、さらに溶媒を留去し、 $1\,\mathrm{NMR}$ の供配化合物の生成を確認した。

産業上の利用可能性



本発明により、近年活発に研究開発がなされている種々の経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物の効率的かつ容易な合成が可能となり、本発明は工業的に有用なものである。

請求の範囲

1. 一般式(1):

$$H_3C$$
 H_3C
 H_3C
 CO_2
 O
 R_2
 R_2

10

5

(式中、 R_1 は水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示し、 R_2 は炭素数 $1\sim1$ 0 のアルキル基または炭素数 $3\sim1$ 0 のシクロアルキル基を示す)で表される化合物と、一般式(3):

$$R_3$$
—SH (3)

15

(式中、 R_3 は有機基を示す)で表されるチオール化合物を塩基の存在下に反応させ、必要に応じて保護基 R_1 を脱保護することを特徴とする、一般式(2):

20

$$H_3C$$
 OR_4
 H
 H
 CH_3
 $S-R_3$
 CO_2
 O
 R_2

- 25 (式中、 R_2 、 R_3 は前記と同じ意味を示し、 R_4 は水素原子、トリメチルシリル 基またはトリエチルシリル基を示す)で表される化合物の製造方法。
 - 2. R₂がtertーブチル基である請求の範囲第1項に記載の製造方法。

3. R₃が式(4):

$$HS \longrightarrow N \longrightarrow N$$
 (4)

- 5 で示されるチオール化合物のチオール残基である請求の範囲第1または2項に記載の製造方法。
 - 4. R₃が式(5):

10

15

で示されるチオール化合物のチオール残基である請求の範囲第1または2項に記載の製造方法。





国際出願番号 PCT/JP03/14420

Int. Cl' C07D477/06, C07F7/18								
B. 関連を行った分野 両定を行った泉小阪資料 (国際特許分類(I P C)) I n t . C 1 [*] C 0 7 D 4 7 7 / 0 6, C 0 7 F 7 / 1 8 最小投資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 国際競金で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) STN/CIS C. 勝連すると認められる文献	A. 発明の風する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))							
Int. Cl' C07D477/06, C07F7/18 最小限資料以外の資料で開壺を行った分野に含まれるもの	Int. Cl' C07D477/06, C07F7/18							
Int. Cl' C07D477/06, C07F7/18 日本国際特別が (1PC)	p 図本を分	たった今時						
日 n t. C l ** C 0 7 D 4 7 7 / 0 6, C 0 7 F 7 / 1 8 最小段資料以外の資料で悶査を行った分野に含まれるもの 国際調査で使用した電子データペース(データペースの名称、調査に使用した用語) STN/CAS	調査を行った最	h小限資料(国際特許分類(IPC))						
国際調査で使用した電子データペース(データペースの名称、調査に使用した用語) STN/CAS C. 関連すると認められる文献 引用文献の カアゴリー*								
C. 関連すると認められる文献 引用文献の カデゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 だっています。	最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの						
C. 関連すると認められる文献 引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が弱連するときは、その関連する箇所の表示 対								
明用文献のカテゴリー* I用文献名 及び一部の箇所が別連するときは、その関連する箇所の表示 EP 559533 A1 (TANABE SEIYAKU CO., LTD.) 1993.09.08 Claim 8, lines 8-33 of page 3, line 57 of page 4 to line 1 of page 5 & JP 5-279367A & CA 2085540 A & US 5414081 A & US 5589592 A FEP 632039 A1 (LEDERLE (JAPAN), Ltd.) 1995.01.04 & NO 942483 A & FI 943164 A & CA 2127193 A & EP 632039 A & JP 8-53453 A & IL 116331 A & ZA 6404720 A & NO 955007 A & FI 955954 A & CA 2164918 A & ZA 9510546 A & EP 717042 A, 他 E C個の続きにも文献が列挙されている。 * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すしたの「B」国際出題目前の出題または特許であるが、国際出題目前り後に公表された文献であって、当版文献であって、当版文献のみで発明の近端に対き性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明「アリー国際出題目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出題「大力で対したの、当業者にとって自用である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「企」同一パテントファミリー文献 国際調査を持つ発送日 24.2.2004 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915	国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) STN/CAS							
明用文献のカテゴリー* I用文献名 及び一部の箇所が別連するときは、その関連する箇所の表示 EP 559533 A1 (TANABE SEIYAKU CO., LTD.) 1993.09.08 Claim 8, lines 8-33 of page 3, line 57 of page 4 to line 1 of page 5 & JP 5-279367A & CA 2085540 A & US 5414081 A & US 5589592 A FEP 632039 A1 (LEDERLE (JAPAN), Ltd.) 1995.01.04 & NO 942483 A & FI 943164 A & CA 2127193 A & EP 632039 A & JP 8-53453 A & IL 116331 A & ZA 6404720 A & NO 955007 A & FI 955954 A & CA 2164918 A & ZA 9510546 A & EP 717042 A, 他 E C個の続きにも文献が列挙されている。 * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すしたの「B」国際出題目前の出題または特許であるが、国際出題目前り後に公表された文献であって、当版文献であって、当版文献のみで発明の近端に対き性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「ス」特に関連のある文献であって、当版文献のみで発明「アリー国際出題目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出題「大力で対したの、当業者にとって自用である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「企」同一パテントファミリー文献 国際調査を持つ発送日 24.2.2004 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915		・ し 可 込 と ね て 小 節						
アテゴリー*								
		引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	: きは、その関連する箇所の表示					
Table 8	X	EP 559533 A1 (TANABE SEIYAKU CO.,)	LTD.) 1993.09.08	1				
### A Mark	Y	Claim 8,		3-4				
Y		lines 8-33 of page 3, line 57 of 1	page 4 to line 1 of page 5					
& NO 942483 A & FI 943164 A & CA 2127193 A & EP 632039 A & JP 8-53453 A & IL 116331 A & ZA 6404720 A & NO 955007 A & FI 955954 A & CA 2164918 A & ZA 9510546 A & EP 717042 A, 他 ② C欄の続きにも文献が列挙されている。 ③ パテントファミリーに関する別紙を参照。 ② パテントファミリーに関する別紙を参照。 ③ の目の後に公表された文献 「石」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願目以後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「&」同一パテントファミリー文献 国際調査報告の発送目 ② 4. 2. 20 0 4 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100−8915	ĺ	& JP 5-279367A & CA 2085540 A & US 5414081 A & US 5589592 A						
& NO 942483 A & FI 943164 A & CA 2127193 A & EP 632039 A & JP 8-53453 A & IL 116331 A & ZA 6404720 A & NO 955007 A & FI 955954 A & CA 2164918 A & ZA 9510546 A & EP 717042 A, 他 ② C欄の続きにも文献が列挙されている。 ③ パテントファミリーに関する別紙を参照。 ② パテントファミリーに関する別紙を参照。 ③ の目の後に公表された文献 「石」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願目以後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「&」同一パテントファミリー文献 国際調査報告の発送目 ② 4. 2. 20 0 4 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100−8915	v	FD 632030 A1 (FDFRIF (TAPAN) Ltd) 1995. 01. 04	3				
 & JP 8-53453 A & IL 116331 A & ZA 6404720 A & NO 955007 A & FI 955954 A & CA 2164918 A & ZA 9510546 A & BP 717042 A, 他 区 C欄の続きにも文献が列挙されている。 * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「B」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「V」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献でなって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「A」同一パテントファミリー文献 国際調査機関の名称及びあて先日の9.02.2004 国際調査機関の名称及びあて先日の9.02.2004 国際調査機関の名称及びあて先日の9.02.2004 国際調査機関の名称及びあて先日の9.02.2004 特許庁審査官(権限のある職員)日の4 名 2 4 2 2 0 4 4 2 8 5 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	l I	& NO 942483 A & FT 943164 A & CA	2127193 A & EP 632039 A					
 & FI 955954 A & CA 2164918 A & ZA 9510546 A & EP 717042 A, 他 区 C 個の続きにも文献が列挙されている。 ★ 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「B」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表された文献であって、出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の選解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「Q」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「を」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した目 国際調査報告の発送日 24.2.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 中安 智 		& JP 8-53453 A & IL 116331 A & ZA	6404720 A & NO 955007 A					
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に冒及する文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「B」国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 事項便番号100-8915	ł	& FI 955954 A & CA 2164918 A & ZA	. 9510546 A & EP 717042 A,他					
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に冒及する文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「B」国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 事項便番号100-8915								
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に冒及する文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「B」国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 事項便番号100-8915		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	□ パニントラーニリーに関する別	単を参照				
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日	X C欄の統	きにも文献が列挙されている。	「 ハックトンテミューに関するか	IAA E E ANO				
もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 次就 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に冒及する文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 19.02.2004 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)	[T 7///\subsection 1/// 1							
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「B」国際調査を完了した日の9.02.2004 国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP) 事項便番号100-8915		進のある文献ではなく、一般的技術水準を示す						
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「B際調査を完了した日 国際調査を完了した日 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915	「F.」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの							
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せに上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「を」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 24. 2. 2004 国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 特許庁審査官(権限のある職員)中学報								
文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した目 09.02.2004 国際調査報告の発送日 24.2.2004 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 特許庁審査官 (権限のある職員) 中安 智			「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以				
「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した目 国際調査報告の発送日 24. 2. 2004 国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP) 事便番号100-8915 特許庁審査官(権限のある職員)中安容 4C 8519	文献 (理由を付す)						
国際調査機関の名称及びあて先	「O」ロ頭による阴示、使用、展示等に背及する文献 よって運歩性がないと考えられるもの 「P 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献							
日本国特許庁(ISA/JP) 守安智 印 郵便番号100-8915	国際調査を完	了した日 09.02.2004	国際調査報告の発送日 24.	2. 2004				
日本国特許庁 (ISA/JP) 守安 智 印 郵便番号100-8915	国際調査機関	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4C 8519				
	日本	国特許庁(ISA/JP)		,				
			電話番号 03-3581-1101	内線 3452				

国	IEX.	SIE	*	±Π	4
压	烼	伽	12	70	т

国際出願番号 PCT/JP03/14420

C(続き).	き)・ 関連すると認められる文献				
C(続き)・ 引用文献の	· 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
カテゴリー* Y	JP 10-130270 A (三共株式会社) 1998.05.19	4			
1	(ファミリーなし)				
ŀ					
		}			
		· ·			